

【 登録特許 】

	発明名称(外国名)	権利者	公開番号(年月日)	特許登録番号(年月日)
1	微生物を用いた水素製造方法	RITE シャープ株式会社	2005-87035 (2005年4月7日)	4409893 (2009年11月20日)
2	水処理用ゼオライト触媒の製造方法	RITE 日揮触媒化成株式会社	2005-131547 (2005年5月26日)	4439872 (2010年1月15日)
3	水素生産能を有する微生物の培養装置および生物的水素製造方法	RITE シャープ株式会社	2006-55128 (2006年3月2日)	4440732 (2010年1月15日)
4	コリネ型細菌形質転換体及びそれを用いるジカルボン酸の製造方法	RITE	WO2005/010182 (2005年2月3日)	4451393 (2010年2月5日)
5	ガスエンジンの燃焼制御方法及びその装置	RITE 三菱重工株式会社	2005-240583 (2005年9月8日)	4452092 (2010年2月5日)
6	硝酸性窒素含有水の処理方法	RITE 日揮触媒化成株式会社	2006-000687 (2006年1月5日)	4450677 (2010年2月5日)
7	組換え型コリネ型細菌を用いるエタノールの製造方法(ドイツ、フランス、スペイン)	RITE	1291428 (2003年3月12日)	1291428 (2010年2月24日)
8	微生物の培養装置、それを用いる水素生産装置および燃料電池システム	RITE シャープ株式会社	WO2005/087911 (2005年9月22日)	4476285 (2010年3月19日)
9	コリネ型細菌形質転換体及びそれを用いるジカルボン酸の製造方法(ドイツ、フランス、イギリス、デンマーク、オランダ、スイス)	RITE	1647594 (2006年4月19日)	1647594 (2010年3月24日)
10	組換え型コリネ型細菌を用いるエタノールの製造方法(中国)	RITE	1436240 (2003年8月13日)	1811146.7 (2010年4月28日)
11	リチウム二次電池電極材のリサイクル処理方法及び装置(米国)	RITE 川崎重工株式会社	2005-0241943 (2005年11月3日)	7713396 (2010年5月11日)
12	好気性細菌による高効率な有機酸の製造方法	RITE	2006-197821 (2006年8月3日)	4537862 (2010年6月25日)
13	プラズマ反応器	RITE	2005-268129 (2005年9月29日)	4546123 (2010年7月9日)
14	酸洗廃液の処理方法および酸洗廃液用処理装置	RITE、JFEスチール株式会社 JFEテクノリサーチ株式会社 株式会社アストム 株式会社ササクラ	2006-131962 (2008年5月25日)	4544970 (2010年7月9日)
15	微生物を用いる水素生産装置、およびそれを用いる燃料電池システム	RITE シャープ株式会社	2006-217829 (2006年8月24日)	4574375 (2010年8月27日)
16	水素製造方法および水素製造装置	RITE シャープ株式会社	2006-333767 (2006年12月14日)	4588541 (2010年9月17日)
17	水素生成能力に関する遺伝子が改良された微生物およびその微生物を用いた水素の製造方法	RITE シャープ株式会社	2007-209334 (2007年8月23日)	4588693 (2010年9月17日)
18	水素生成能力に関する遺伝子が改良された微生物およびその微生物を用いた水素生成方法(米国)	RITE シャープ株式会社	2007-202585 (2007年8月30日)	7816109 (2010年10月19日)
19	汚染物質処理方法	RITE 株式会社大林組	2002-18425 (2002年1月22日)	4630427 (2010年11月19日)
20	ガス分離膜及びガス分離方法	RITE	2007-54710 (2007年3月8日)	4641899 (2010年12月10日)
21	コリネ型細菌による高効率なジカルボン酸の製造方法	RITE	2006-320278 (2006年11月30日)	4647391 (2010年12月17日)
22	水素生産能を有する微生物の培養方法および水素生産方法	RITE シャープ株式会社	2006-320241 (2006年11月30日)	4652124 (2010年12月24日)

【 公開特許 】

	発明名称	出願人	公開番号(年月日)	特許登録番号(年月日)
1	草本類バイオマスの糖化処理方法	RITE 中部電力株式会社	2010-110230 (2010年5月20日)	
2	高分子膜及びその利用	RITE	2010-149026 (2010年7月8日)	
3	複合中空系膜の製造方法	RITE 株式会社クラレ	2010-155204 (2010年7月15日)	

登録特許および公開特許一覧表

	発明名称	出願人	公開番号(年月日)	特許登録番号(年月日)
4	耐水性に優れるガス分離膜用ビニルアルコール系重合体複合膜	RITE 株式会社クラレ	2010-155205 (2010年7月15日)	
5	耐水性に優れるガス分離膜用シリル基含有ビニルアルコール系重合体複合膜	RITE 株式会社クラレ	2010-155206 (2010年7月15日)	
6	ガス分離膜用エチレン-ビニルアルコール系重合体複合膜	RITE 株式会社クラレ	2010-155207 (2010年7月15日)	
7	コロナ型細菌形質転換体及びそれを用いるイソプタノールの製造方法	RITE	WO2010/113832 (2010年10月7日)	
8	イオン液体を用いた物理吸収法による二酸化炭素分離回収方法	RITE 独立行政法人産業技術総合研究所	2010-248052 (2010年11月4日)	
9	光電変換素子	RITE ソニー株式会社	2010-287911 (2010年12月24日)	